

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成26年12月4日 (2014.12.4)

【公表番号】特表2013-534370(P2013-534370A)

【公表日】平成25年9月2日 (2013.9.2)

【年通号数】公開・登録公報2013-047

【出願番号】特願2013-524857(P2013-524857)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/285 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 21/768 (2006.01)

H 0 1 L 23/532 (2006.01)

H 0 1 L 21/8247 (2006.01)

H 0 1 L 27/115 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 21/285 S

H 0 1 L 21/88 R

H 0 1 L 27/10 4 3 4

【誤訳訂正書】

【提出日】平成26年10月1日 (2014.10.1)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 3 9

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 3 9】

図 1 4 - 図 1 6 は、バリア 3 6 (図 5) が省略される例示的な一実施形態を示す。図 1 4 は、図 5 の処理段階に類似した処理段階における半導体構造 3 0 b を示す。構造 3 0 b は、図 5 を参照して上述された、ベース 3 2 および絶縁性材料 3 4 を含む。開口 4 0 - 4 2 は、絶縁性材料 3 4 へと伸長する。ライナー 8 0 は、絶縁性材料 3 4 の上部表面にわたって、開口 4 0 - 4 2 内で伸長し、ライナーは、開口の側壁をライニングする。ライナー 8 0 は、ルテニウムおよびコバルトのうちの一つもしくはその双方と合金された遷移金属 (例えば、タンタル) を含むか、本質的にルテニウムおよびコバルトのうちの一つもしくはその双方と合金された遷移金属で構成されるか、ルテニウムおよびコバルトのうちの一つもしくはその双方と合金された遷移金属で構成されてもよい。幾つかの実施形態においては、ライナー 8 0 は、ルテニウムおよびコバルトのうちの一つもしくはその双方と結合した一つ以上の遷移金属 (例えば、タンタル) 及び窒素を含むか、本質的にルテニウムおよびコバルトのうちの一つもしくはその双方と結合した一つ以上の遷移金属 及び窒素で構成されるか、ルテニウムおよびコバルトのうちの一つもしくはその双方と結合した一つ以上の遷移金属 及び窒素で構成されてもよい。